

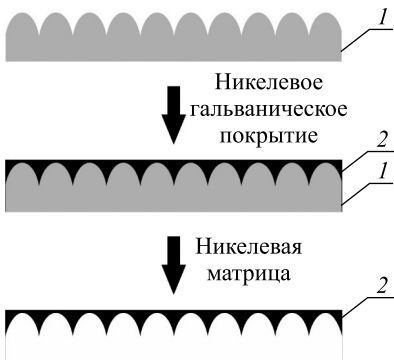
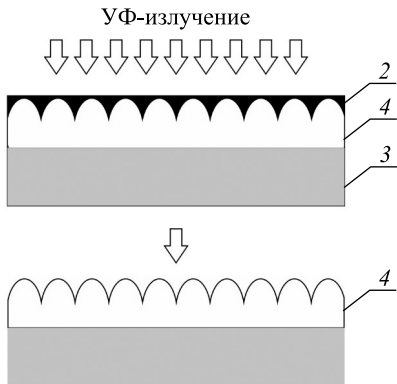
a/a*б/б*

Рис. 5. Создание микрорельефной структуры микроизображений в никелевой матрице с помощью процесса электролитического формования (*а*) и перенос микрорельефной структуры на полимерную пленку (*б*):
 1 – микрорельефная структура микроизображений; 2 – никелевая матрица;
 3 – полимерная пленка; 4 – УФ-отверждаемый полимер

Fig. 5. Creation of microrelief microimage structure in a nickel matrix using an electrolytic molding process (*a*) and transfer of microrelief structure onto a polymer film (*b*):
 1 – microrelief microimage structure; 2 – nickel matrix;
 3 – polymer film; 4 – UV curable polymer